

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 3 部門第 1 区分

【発行日】平成 26 年 11 月 27 日 (2014.11.27)

【公開番号】特開 2013-95635 (P2013-95635A)

【公開日】平成 25 年 5 月 20 日 (2013.5.20)

【年通号数】公開・登録公報 2013-025

【出願番号】特願 2011-240104 (P2011-240104)

【国際特許分類】

C 0 1 B 31/36 (2006.01)

【F I】

C 0 1 B 31/36 6 0 1 H

【手続補正書】

【提出日】平成 26 年 10 月 8 日 (2014.10.8)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 0 2 8

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0 0 2 8】

[合成例 2]

水ガラス溶液（富士化学（株）製：S i O₂ / N a₂ O（モル比）= 3 . 2 0）1 4 0 g に、水 3 5 g を加えて混合し、S i 濃度 1 0 質量 % の水ガラス溶液を得た。

得られた水ガラス水溶液 6 6 . 2 g を硫酸濃度 1 0 . 7 体積 % の硫酸（水 1 6 5 . 6 m l に濃硫酸 2 0 m l を混合したもの）2 0 0 g 中に滴下し、常温（2 5 ）下で沈降性シリカを析出させた後、減圧下でブフナー漏斗を用いて固液分離し、S i O₂ を含む固形分（沈降性シリカ）2 8 . 9 g と、不純物を含む液分 2 3 7 . 3 g を得た。なお、p H は滴下終了時まで 1 . 0 以下に保った。

得られた S i O₂ を含む固形分（沈降性シリカ）に対して、常温（2 5 ）下で硫酸濃度 1 0 . 7 体積 % の硫酸を 2 0 0 g 添加して p H が 3 . 0 未満のスラリーとした。このスラリーを固液分離した後に、得られた固形分を、蒸留水を用いて水洗した。その後、水洗した固形分を 1 0 5 で 1 日乾燥させ、高純度シリカ 1 4 . 5 g を得た。

得られた高純度シリカにカーボン（東海カーボン社製：平均粒径 1 m m）を 2 . 8 g 加えて混合し、高純度シリカとカーボンの混合物を得た。

得られた高純度シリカとカーボンの混合物中の不純物（B、P、A l、C u、F e、M g、C a、N i、T i）の濃度を、上述した分析方法を用いて測定した。その結果を表 1 に示す。

得られた高純度シリカとカーボンの混合物は、S i の回収率が 9 7 . 0 % であった。

また、得られた高純度シリカとカーボンの混合物（C / S i O₂ のモル比：3 . 5）1 0 g を管状炉に入れて、1 6 5 0 で 3 時間、アルゴン雰囲気下で焼成した。得られた焼成物について X 線回析を行った。結果を図 3 に示す。